
Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)



Leibniz Institute
for high
performance
microelectronics

Technische Parameter

Photoelektronenspektrometer:

PHI VersaProbe II

Röntgenquelle:

Aluminiumanode (Al $K\alpha$, Photonenenergie
1486,6 eV)

Ionenquelle: Ar⁺ (Energie 0.25-5 keV)

Primärstrahl: monochromatisierter

Al $K\alpha$ - 1486,6 eV

Detektiertes Signal: Photoelektronen

Detektierte Elemente: Li – U

Informationen über chemische Bindungen

Lateralauflösung: 10 μm – 100 μm

Tiefenauflösung: 2 – 3 nm (Tiefenprofile)

1 – 10 nm (Oberflächenanalyse)

Nachweisempfindlichkeit: 0.5 at.%



Einsatzgebiete

- Oberflächenanalyse
- Tiefenprofilanalyse
- Verunreinigungsanalyse

Ansprechpartner

Dr. Ioan Costina

Telefon: +49 335 5625 370

Fax: +49 335 5625 327

Email: [costina@ihp-
microelectronics.com](mailto:costina@ihp-microelectronics.com)